

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาข้อสัมผัสไอห์มิกของฟิล์มนางแคลเมี่ยมเทลลูไรค์ เมื่อมาจากข้อสัมผัสไอห์มิกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดประสิทธิภาพสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มนางแคลเมี่ยมเทลลูไรค์ งานวิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงอิทธิพลของข้อสัมผัสของ Sb_2Te_3 ที่มีต่อความเป็นไอห์มิกรวมทั้งค่าความด้านทานจำเพาะของข้าไฟฟ้า (ρ_c) และความสูงของกำแพงศักย์ซึ่งเกิดจากการอยู่ต่อระหว่างแคลเมี่ยมเทลลูไรค์กับทองแดง การวิจัยนี้เริ่มจากการเตรียมฟิล์มนาง CdTe และ Sb_2Te_3 โดยวิธีระเหยสารเคมีด้วยความร้อนภายใต้ระบบสูญญากาศ เคดีอบบนแพ่นฐานรองรับที่เป็นกระจกสไลด์และที่เป็นฟิล์มนางของทองแดงบริสุทธิ์ ตรวจสอบโดยการสร้างผลึกโดยวิธีการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ และตรวจสอบผิวน้ำผลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกล้อง เห็นว่าแกนพลังงานของฟิล์มนาง CdTe หาได้จากการวัดเบอร์เซนต์ การส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง ยูวี-วิสิเบลสเปกโตร โฟโต้มิเตอร์ งานนี้จึงทำการประดิษฐ์ และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสิ่งประดิษฐ์ของฟิล์มนาง CdTe ที่มีโครงสร้างแบบ Cu/CdTe/Cu, $Sb_2Te_3/CdTe/Sb_2Te_3$ และ $Cu/CdTe/Sb_2Te_3/Cu$ โดยอาศัยการไอลของกระแสไฟฟ้าทั้งในแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน จากแบบจำลองความสูงของกำแพงศักย์สำหรับค่าที่กับแบบจำลองที่ความสูงของกำแพงศักย์ ไม่สำหรับค่าที่กับเวนผิวน้ำสัมผัสของทรายภูมิเทอร์มิโนนิกอิมิชันสามารถที่จะหาหารามิเตอร์ที่สำคัญของรอยต่อได้ จากผลการทดลองพบว่าความด้านทานจำเพาะของรอยต่อ ความสูงของกำแพงศักย์ที่มี Sb_2Te_3 เป็นขั้นได้โพลาร์วูมิค่าต่ำในระดับ 8.15×10^{-3} ไอห์ม-ตารางเซนติเมตร และ 0.201 อิเล็กตรอน โวลต์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องดีกับค่าที่ยอมรับได้ในชิงพานิชย์คืออยู่ในช่วง $10^{-2} - 10^{-6}$ ไอห์ม-ตารางเซนติเมตร อีกทั้งยังได้ประดิษฐ์ได้โดยของฟิล์มนาง n-CdS/p-CdTe โดยวิธีการระเหยสารเคมีด้วยความร้อนภายใต้ระบบสูญญากาศ จากการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้า จะได้หารามิเตอร์ที่สำคัญของໄโค ได้แก่ แฟกเตอร์อุณหภูติ ความสูงของกำแพงศักย์ และแรงดันตกคร่อมตรงบริเวณรอยต่อซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.20, 0.593 อิเล็กตรอน โวลต์ และ 0.415 โวลต์ ตามลำดับ

ABSTRACT**229038**

This research has been studied the ohmic contact of CdTe thin films. The ohmic contact is one most important parameter to specify the efficiency of CdTe solar cells. This research has been emphasized the role of Sb_2Te_3 layer to the ohmicity, the specific contact resistance (ρ_c) and barrier height that formed after making contact between CdTe and copper. CdTe and Sb_2Te_3 thin films have been deposited by thermal evaporation in vacuum on slide glass substrate and on pure Cu layer coated on slide glass substrate. Crystal structure and crystal morphology of these films were checked by XRD and SEM, respectively. The optical transmission spectrum of CdTe thin films were performed by UV-VIS spectrophotometer. Then, energy gap value of the films was evaluated from it. Furthermore, semiconductor devices have been fabricated on the structure of Cu/CdTe/Cu, Sb_2Te_3 /CdTe/ Sb_2Te_3 and Cu/CdTe/ Sb_2Te_3 /Cu. Electrical properties of these devices were examined by using the vertical and lateral transmission methods. A point of view of the thermionic emission theory with homogeneous and inhomogeneous barrier height models, important parameters of these devices were extracted from the experimental results. The specific contact resistance (ρ_c) and barrier height values are $8.15 \times 10^{-3} \Omega \text{-cm}^2$ and 0.201 eV, respectively. In commercial, the value of specific contact resistance of ohmic contact of electronics devices should be in the range of 10^{-2} - $10^{-6} \Omega \text{-cm}^2$. Thus, specific contact resistance of ohmic contact of CdTe thin films is well acceptable. Moreover, n-CdS/p-CdTe thin film diode was fabricated by thermal evaporation in vacuum. Ideality factor, barrier height and built-in voltage values having about 1.20, 0.593 eV and 0.415 V were evaluated from I-V and C-V measurements at room temperature.